

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成 19 年 11 月 15 日 (2007.11.15)

【公開番号】特開 2005-291874 (P2005-291874A)

【公開日】平成 17 年 10 月 20 日 (2005.10.20)

【年通号数】公開・登録公報 2005-041

【出願番号】特願 2004-106462 (P2004-106462)

【国際特許分類】

G 0 1 N 21/956 (2006.01)

【F I】

G 0 1 N 21/956 A

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 9 月 27 日 (2007.9.27)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 4 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 4 3】

この第 2 の実施の形態のムラ欠陥検査装置 20 は、照明装置 12 をフォトマスク 50 の下方に配置したものである。従って、受光器 13 は、照明装置 12 から照射され、フォトマスク 50 のチップ 55 における繰り返しパターン 51 間を透過する透過光、特にこの透過光のうち、単位パターン 55 のエッジ部で回折された回折光を受光し、受光データに変換する。